

CVS로 합성된 (V, W, Mo)-doped TiO₂ 나노분말의 구조분석
 Microstructural analyses of (V, Mo, W)-doped TiO₂ nanopowders
 synthesized by AACVS

지현석^{1*}, 박 훈^{1,2}, 서경원^{1,3}, 안재평¹, 박종구¹

1. 한국과학기술연구원 나노재료연구센터
2. 고려대학교 재료공학과
3. 고려대학교 화학생명공학과

TiO₂ 나노분말은 아나타제(anatase), 루틸(rutile), 부루카이트(brookite) 등 여러 상(phase)을 갖고 있다. 약 50nm 정도의 작은 크기를 갖는 TiO₂ 나노분말은 광화학반응을 일으키는 반도체 특성을 나타내는데 TiO₂의 아나타제(anatase)상은 밴드갭이 3.2eV이며 태양에너지로부터 전기를 얻거나 물을 분해하여 수소를 합성하거나 공해물질을 분해하는 등에 폭넓게 사용되고 있다. TiO₂ 나노분말은 기상법(AACVS 또는 화염법, 가수분해법(수증기 등) 또는 액상법(sol-gel, 가수분해법 등)으로 합성된다. 지금까지 합성된 TiO₂ 나노분말은 태양광의 5% 미만을 활용할 수 있는 한계점을 갖고 있어서 넓은 파장 범위에서 사용 가능하도록 하기 위하여 불순물 첨가(doping) 등의 많은 연구가 진행되고 있다. 본 연구에서는 V, Mo, W 등의 불순물(dopants)을 TiO₂에 첨가하기 위하여 AACVS(Aerosol-Assisted Chemical Vapor Synthesis)법을 이용하였으며 V, Mo, W 등의 불순물(dopants)이 첨가된 10nm 크기의 균일한 크기의 구형 티타니아 분말을 얻었다. TiO₂ 전구체는 TTIP (Tetra-Titanium Isopropoxide)를 사용하였고 불순물 (dopants) 전구체는 V(Vanadium oxitriisopropoxide), Mo(Molebudeum Isopropoxide), W (Tungsten Isopropoxide)를 전구체로 사용하였다. 전구체 이송가스로는 헬륨가스를, 산화제로 산소가스를 사용하여 헬륨가스 / 산소가스=5.0 / 3.0 slm 유량 조건에서 합성하였다. 합성된 분말은 재료의 상분석을 위해 XRD(Bruker D8 Advance) 미세구조 분석을 위해 HR-TEM(Tecnai G2), 그 외 DRS (Diffused Reflectance Spectroscopy), EPR (Electron Paramagnetic Resonance) 등을 이용하여 관찰하였다. 그림 1.은 vanadium 첨가량에 따른 XRD 회절 분석결과이다. XRD회절 결과에 있어 도핑에 따른 2차상은 나타나지 않고 있어서 균일한 도핑이 되는 것을 확인할 수 있다. 0.1%로부터 10%까지 vanadium 을 첨가함에 따라 anatase (101) 이 1%부터 저각으로 이동하는것이 보이는데 이는 TiO₂ 에 불순물(dopants)이 첨가됨에 따라 TiO₂ 내의 팔면체 층은 사면체를 왜곡시킴을 의미한다.

불순물 (dopants) 첨가량에 따른 anatase의 반각폭(FWHM) 변화는 거의 없어서 첨가에 따른 입자크기변화는 거의 없음을 알 수 있다. 그림 2는 W, Mo 첨가량에 따른 XRD 회절 분석결과이다. V의 경우와는 달리 W, Mo 첨가량에 따른 anatase (101)의 이동은 관찰할 수 없었다. 따라서 TiO₂의 장범위 규칙성을 도핑에 의해서 왜곡되는 것은 V의 경우보다 덜 한 것으로 나타났으며 V의 경우가 화학적 친화성(chemical affinity)이 더 좋은 것으로 나타났다. 그림 3은 vanadium 첨가량에 따른 투과전자현미경 관찰 결과이며 VxOy 등의 이차상은 발견할 수 없었고 매우 균일한 크기의 아나타제 분말이 합성되었음을 알 수 있다.

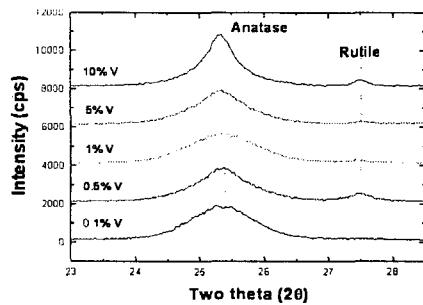


Fig. 1 X-ray diffraction pattern of V doped.

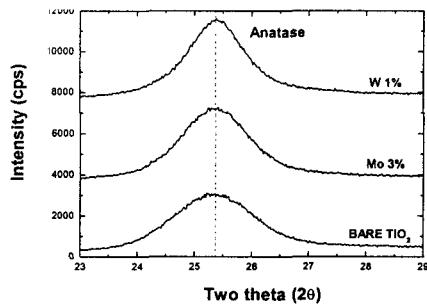


Fig. 2 X-ray diffraction pattern of Mo, W doped.

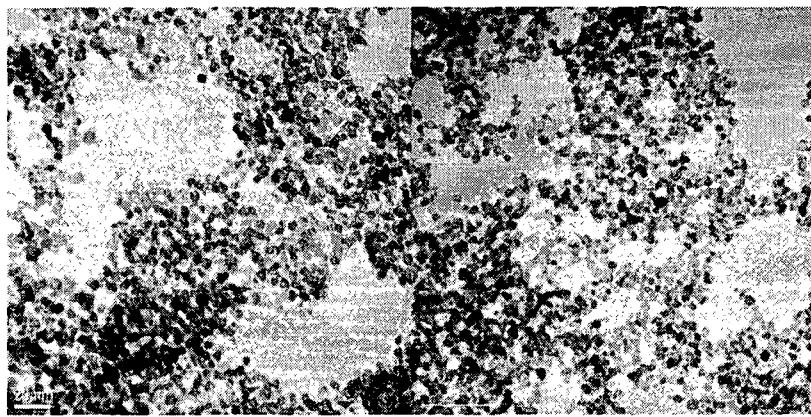


Fig. 3. TEM microstructure of TiO₂ nanopowder (a) Undoped TiO₂, (b) Vanadium 1.0% doped